

ジオマテック 株式会社

薄膜・加工技術のプロ集団で最高の価値とソリューションを提供

企画・研究 開発・設計 試作/小ロット 生産 資材調達 組立 検査・評価

製品・技術の特徴

■技術の特徴

【真空成膜技術】

- ・多彩な成膜物質に対応可能 (金属膜、酸化膜、合金膜など)
- ・スパッタリング、EB(電子銃)蒸着、イオンプレーティング、抵抗加熱蒸着、イオンアシスト等

【加工可能サイズ】

- ・MAX 730×920mm

【可能加工材質】

- ・硝子基板、樹脂フィルム基板等

【洗浄技術】

- ・極薄基板可(全自動超音波洗浄機)

【微細加工技術】

- ・微細エッチング加工 (ウエットエッチング、ドライエッチング)

■製品紹介

- ・透明導電膜(ITO)
- ・加飾コーティング
- ・測温/温調(透明ヒーター)
- ・光学用薄膜
- ・レーザー用光学系
- ・電池/エネルギー
- ・金属膜/金属電極膜
- ・DLCコーティング
- ・フィルム/ロール成膜
- ・測定サービス

■新薄膜製品

- ・薄膜熱電対、薄膜二次電池、DLC膜、マスクブランクス、他



高耐久性透明導電膜(太陽電池部材) 透明電極膜:ITO膜

お問い合わせ先

【担当】
営業部

【TEL】
045-222-5721

【FAX】
045-222-5731

【E-mail】
sales@geomatec.co.jp

企業情報

【URL】
<http://www.geomatec.co.jp>

【所在地】
本社 〒220-8109
神奈川県横浜市西区
みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー9階
tel 045-222-5720
fax 045-222-5735

〒989-5164
栗原市金成金生51
tel 0228-42-3001
fax 0228-42-3000

【代表者】
代表取締役 松崎隆浩

【資本金】
40億4,385万円

【従業員】
工場 163人
本社 489人

【沿革(設立)】
1953年 設立
1975年 金成第一工場建設
1987年 金成第二工場建設

【面積(敷地工場)】
敷地 53,816㎡
建物 23,400㎡(金成第二工場)

【社屋写真】金成第二工場



事業の概要

(事業の特徴、生産品目/生産高(ロット)/売上高、取引先、設備)

■事業内容

- ・フラットパネルディスプレイ用基板 (液晶ディスプレイ用、EL用、タッチパネル用)
- ・光学機器用部品
- ・固体レーザー用光学系部品
- ・その他真空成膜製品の製造及び販売 他

■生産設備

名 称	メーカー	台数
超音波洗浄装置	各種	多数
パッチ式真空成膜装置	各種	多数
連続式(CES)真空成膜装置	各種	数台
ロール式真空成膜装置	各種	1台

■売上高

2008年	86億3,800万円
2007年	163億1,700万円
2006年	161億 900万円

■取引先

SMK㈱
エプソンイメージングデバイス㈱
ガンゼ㈱、三洋電機㈱
シャープ㈱、日本サムスン㈱
パナソニック㈱
㈱日立ディスプレイズ
光村印刷㈱、㈱菱晃